

## ナノテクノロジー融合ステーションナノ集積ライン 利用料金表

※平成26年4月1日より適用

(税抜表示)

No.	分類	装置名	機器利用	技術補助・技術代行
1	リソグラフィ	125kV電子ビーム描画装置	¥2,500	¥3,550
2		100kV電子ビーム描画装置	¥1,500	¥2,550
3		高速マスクレス露光装置	¥1,000	¥2,050
4		レーザー露光装置	¥500	¥1,550
5		ナノインプリント装置	¥500	¥1,550
6		マスクアライナー	¥500	¥1,550
7		CAD作成	設定なし	¥1,550
8	薄膜形成	全自動スパッタ装置	¥500	¥1,550
9		超高真空スパッタ装置	¥500	¥1,550
10		12連電子銃型蒸着装置	¥500	¥1,550
11		超高真空電子銃型蒸着装置	¥500	¥1,550
12		原子層堆積装置	¥500	¥1,550
13		プラズマCVD装置	¥500	¥1,550
14	ドライエッチング	多目的ドライエッチング装置	¥500	¥1,550
15		化合物ドライエッチング装置	¥500	¥1,550
16		シリコン深堀エッチング装置	¥500	¥1,550
17		酸化膜ドライエッチング装置	¥1,000	¥2,050
18	FIB加工	FIB-SEMダブルビーム装置	¥1,500	¥2,550
19	熱処理	急速赤外線アニール炉	¥500	¥1,550
20		シリコン酸化・熱処理炉	¥500	¥1,550
21	観察・評価	走査電子顕微鏡	¥500	¥1,550
22		原子間力顕微鏡	¥500	¥1,550
23		3次元測定レーザー顕微鏡	¥500	¥1,550
24	切削・研磨	ダイシングソー	¥500	¥1,550
25		自動スクライパー	¥500	¥1,550
26		CMP研磨装置	¥500	¥1,550
27	電気計測	室温プローバシステム	¥500	¥1,550
28		極低温プローバシステム	¥500	¥1,550
29		ワイヤーボンダー	¥500	¥1,550
30	ウェットプロセス	基板洗浄プロセス	設定なし	¥1,550
31		リフトオフプロセス	設定なし	¥1,550
32		レジスト剥離プロセス	設定なし	¥1,550
33		ウェットエッチング	設定なし	¥1,550

**本表料金はNIMS所属ユーザーに限り適用**

### 【備考】

1. 本表は1時間当たりの装置利用に係る金額であり、これに利用時間(※)を乗じた金額が利用料金となります
2. 30分未満の利用については30分として算出し、以後30分単位で利用料金を算出します
3. 利用時間は装置予約時間に準じます(装置立ち上げ時間・終了作業時間含む)
4. CAD作成およびウェットプロセスの利用時間は、スタッフ作業時間に準じます

※ 利用時間について・・・

仮に3時間予約して、実際の装置使用時間が2時間であった場合も3時間分の料金が発生します

また、予約時間を超過して利用した場合は、超過分の追加料金が発生します